【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和4年4月13日(2022.4.13)

【公開番号】特開2021-114548(P2021-114548A)
【公開日】令和3年8月5日(2021.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2021-035
【出願番号】特願2020-6880(P2020-6880)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ 21/338(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 29/786(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 21/336(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ 29/80 Ｈ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６１８Ｂ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６１８Ｆ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６１８Ｅ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ６１８Ａ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ３０１Ｂ
Ｈ０１Ｌ 29/78 ３０１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】令和4年4月5日(2022.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
１つの例において、第１領域１１の厚さｔ１（第１向きに沿った厚さ）は、１００ｎｍ以上１０００ｎｍ以下である。１つの例において、第２領域１２の厚さｔ２（第１向きに沿った厚さ）は、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下である。１つの例において、第３領域１３の厚さｔ３（第１向きに沿った厚さ）は、１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下である。第１厚さｔ１は、Ｚ軸方向に沿った第１領域１１の厚さである。第２厚さｔ２、は、Ｚ軸方向に沿った第２領域１２の厚さである。第３厚さｔ３、は、Ｚ軸方向に沿った第３領域１３の厚さである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
図２に示すように、マグネシウム濃度の変化を、Ｚ軸方向に沿った位置ｐＺ（ｎｍ）に対応する横軸と、マグネシウム濃度の対数ＣＭｇ（単位：／ｃｍ^3）に対応する縦軸と、により表すことができる。この場合において、第２変化率ΔＣＭｇ２は、例えば、図２の点ｐ１におけるマグネシウム濃度と、図２の点ｐ３におけるマグネシウム濃度と、で表される。図２の点ｐ１は、第１領域１１と第２領域１２との境界の位置に対応する。図２の点ｐ３は、第２領域１２と第３領域１３との境界の位置に対応する。点ｐ１におけるマグネシウム濃度の対数をＣＭｇ（ｐ１）（単位：／ｃｍ^3）とする。点ｐ３におけるマグネシウムの濃度の対数をＣＭｇ（ｐ３）（単位：／ｃｍ^3）とする。点ｐ１のＺ軸方向に沿っ

た位置をｐＺ（ｐ１）（単位：ｎｍ）とする。点ｐ３のＺ軸方向に沿った位置をｐＺ（ｐ３）（単位：ｎｍ）とする。

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
第３変化率ΔＣＭｇ３は、例えば、図２の点ｐ２におけるマグネシウム濃度と、図２の点ｐ３におけるマグネシウム濃度と、で表される。図２の点ｐ２は、第３領域１３と第２半導体層２０との境界の位置に対応する。点ｐ２におけるマグネシウム濃度の対数をＣＭｇ（ｐ２）（単位：／ｃｍ^{3}）とする。点ｐ２のＺ軸方向に沿った位置をｐＺ（ｐ２）（単位：ｎｍ）とする。